

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 3 区分

【発行日】平成 17 年 12 月 22 日 (2005.12.22)

【公表番号】特表 2005-503451 (P2005-503451A)

【公表日】平成 17 年 2 月 3 日 (2005.2.3)

【年通号数】公開・登録公報 2005-005

【出願番号】特願 2002-579963 (P2002-579963)

【国際特許分類第 7 版】

C 1 0 G 65/12

C 1 0 G 2/00

C 1 0 G 45/64

C 1 0 G 47/16

C 1 0 G 73/02

【F I】

C 1 0 G 65/12

C 1 0 G 2/00

C 1 0 G 45/64

C 1 0 G 47/16

C 1 0 G 73/02

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 3 月 7 日 (2005.3.7)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

炭化水素ストリームから液体燃料を製造するための下記の a) ~ d) を包含する方法：

- a) フィッシャー - トロプシュ合成から軽質留分および重質留分を分離すること、
- b) 重質留分を水素化分解条件下で処理し、加熱された流出物を生成させること、
- c) 加熱された流出物を軽質留分と組み合わせること、ならびに
- d) 組み合わせられた留分を水素化処理すること。

【請求項 2】

水素化分解の条件中に、重質留分を、昇温および（または）昇圧下で、1 層以上の水素化分解触媒床に通すこと、ならびに、組み合わせられた留分を、昇温および（または）昇圧下で、1 層以上の水素化処理触媒床に通すことを包含している、請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

水素化処理が、水素化分解触媒床と同じ反応槽の中にある、1 層以上の水素化処理触媒床中で実施され、その水素化処理触媒床が水素化分解触媒床の下に位置している、請求項 1 記載の方法。

【請求項 4】

水素化処理が、水素化分解触媒床を具備する反応槽と、異なる反応槽の中にある 1 層以上の触媒床中で実施される、請求項 1 記載の方法。

【請求項 5】

水素化処理工程の生成物を、少なくとも軽質留分および残油留分に分離することをさらに包含する、請求項 1 記載の方法。

【請求項 6】

残油留分を水素化分解反応槽にリサイクルすることをさらに包含する、請求項 5 記載の方法。

【請求項 7】

残油留分を潤滑基油原料フィード調製のために使用することをさらに包含する、請求項 5 記載の方法。

【請求項 8】

残油留分を、残油留分の流動点より低い流動点の生成物を製造するための、脱ろう条件で処理することをさらに包含する、請求項 7 記載の方法。

【請求項 9】

残油留分が、SAPO-11, SAPO-31, SAPO-41, SSZ-32又はZSM-5を含む触媒系を用いて脱ろうされる、請求項 8 記載の方法。

【請求項 10】

水素化分解触媒系が、ゼオライト Y, ゼオライト超安定 Y, ZSM-5, ZSM-11, ZSM-48, SAPO-11, SAPO-31, SAPO-37, SAPO-41又はSSZ-32を含む、請求項 1 記載の方法。

【請求項 11】

重質留分が、少なくとも 80 重量%のパラフィンおよび約 1 重量%を超えない酸素化物を含む、請求項 1 記載の方法。

【請求項 12】

軽質留分が少なくとも 0.1 重量%の酸素化物を含む、請求項 1 記載の方法。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 図 1 】

FIGURE

